УСТОЙЧИВОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ СИЛЬНОСВЯ-ЗАННОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СВЕРХРЕШЕТКИ

К.Н. Алексеев 1 , А.Г. Баланов 1,2 , А.Е. Храмов 2,3 , А.А. Короновский 2,3 , В.А.Максименко 2,3 , О.И. Москаленко 2,3

Полупроводниковые сверхрешетки были предложены в 1969 г. Л. Эсаки и Р. Тсу [1] в качестве объекта для изучения квантовомеханических явлений. Они представляют собой структуры, состоящие из чередующихся тонких (порядка 10 нм) слоев различных полупроводниковых материалов. В настоящее время интерес к сверхрешеткам связан с возможностью их использования для создания приборов, работающих в режиме генерации сигналов сверхвысоких частот [2]. Известно, что при приложении разности потенциалов, превышающей некоторое критическое значение, в сверхрешетке возникает генерация колебаний тока. При этом важными задачами являются анализ устойчивости стационарного распределения электрического поля и нахождение критического значения напряжения, необходимого для возникновения колебаний. Подобные исследования были проведены для диода Ганна [3]. Другой важной задачей является анализ характеристик колебательных режимов, таких как частота и амплитуда колебаний. В настоящей работе данные проблемы обсуждаются в рамках аналитической теории устойчивости стационарного состояния полупроводниковой сверхрешетки.

Динамика электронного транспорта в полупроводниковой сверхрешетке без учета диффузии может быть описана при помощи самосогласованной системы уравнений, включающей уравнение непрерывности и уравнение Пуассона

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\beta \frac{\partial}{\partial x} \left(n v_d(F) \right), \quad \frac{\partial F}{\partial x} = v(n-1). \tag{1}$$

Система уравнений (1) записана относительно безразмерных величин, которые связаны с размерными через следующие соотношения:

$$x = x'/L', \quad t = t'/\tau', \quad n = n'/n'_D, \quad F = F'/F'_c, \quad F_c = \hbar/(ed'\tau'),$$

$$\vartheta'_0 = \delta\Delta'd'/(2\hbar), \quad \beta = \vartheta'_0\tau'/L', \quad v = eL'n'_D/(F'_c\varepsilon_r\varepsilon_0),$$
(2)

где d'=8.3 нм — период сверхрешетки, L'=115.2 нм — ее длина, $n'_D=3\times 10^{22}$ м 3 — равновесная концентрация электронов, e>0 — заряд элек-

трона, ε_0 и ε_r =12.5 — электрическая постоянная и относительная диэлектрическая проницаемость материала, соответственно. Параметры τ' =250 фс, δ =1/8.5 характеризуют рассеяние электронов, β =0.03074, ν =15.769. Размерные значения параметров соответствуют полупроводниковым сверхрешеткам, использованным ранее в экспериментальных работах [4].

Зависимость $v_d(F)$, характеризующая скорость электрона в электрическом поле, для случая низких температур и отсутствия магнитного поля может быть получена аналитически в рамках полуклассического подхода [1]

$$v_d(F) = \frac{F}{1 + F^2}. (3)$$

Для проведения анализа устойчивости введем в рассмотрение малые возмущения $\tilde{F}(x,t)$, $\tilde{n}(x,t)$, эволюция которых будет описываться линеаризованными уравнениями системы (1)

$$\frac{\partial \widetilde{n}}{\partial t} = -\beta \frac{\partial}{\partial x} ((n_0 + \widetilde{n})(v_d(F_0) + v_d'(F_0)F')), \quad \frac{\partial \widetilde{F}}{\partial x} = v\widetilde{n}. \tag{4}$$

Выполняя подстановку $\widetilde{n}(x,t) = \widecheck{n}(x)e^{\sigma t}$, $\widetilde{F}(x,t) = \widecheck{F}(x)e^{\sigma t}$, где $\sigma = \lambda - \iota \omega$, из первого уравнения системы (4) можно получить

$$v_{d}(F_{0})\frac{d^{2}\breve{F}}{dx^{2}} + \left(\frac{\sigma}{\beta} + v'_{d}(F_{0})\frac{dF_{0}}{dx} + vn_{0}v'_{d}(F_{0})\right)\frac{d\breve{F}}{dx} + \left(v\frac{dn_{0}}{dx}v'_{d}(F_{0}) + vn_{0}v'_{d}(F_{0}) + vn_{0}v''_{d}(F_{0})\right)\breve{F} = 0$$
(5)

В данном случае зависимость $v_d(F_0)$ задается соотношением (3), а выражение, описывающее распределение электрического поля $F_0(x)$ для заданного напряжения U_{SL} , было ранее получено аналитически в работе [4]. Таким образом, интегрируя выражение (5), можно получить пространственное распределение возмущения электрического поля $\widetilde{F}(x,t)$, характеризующееся коэффициентом нарастания/затухания σ . Отметим, что падение напряжения на сверхрешетке поддерживается постоянным, следовательно, в системе могут существовать только возмущения электрического поля для которых

$$\widetilde{U}_{SL} = \int_{0}^{1} \widetilde{F}(x)dx = 0$$
(6)

В момент, когда стационарное состояние становится неустойчивым, в системе появляется возмущение, коэффициент нарастания λ которого становится положительным. Следовательно, непосредственно в момент

бифуркации, λ =0. Таким образом, в уравнении (5) Re(σ)=0, и его решение при заданном U_{SL} представляет собой набор возмущений, характеризующихся частотой $\omega = \text{Im}(\sigma)$. Далее, применяя граничное условие (6), из полученного набора можно выбрать возмущения, реализующиеся в сверхрешетке при данном значении управляющего параметра U_{SL} . На рис. 1 показаны значения интеграла (6) для возмущений с λ=0 и различными частотами о. При этом сплошной линией показан случай, когда напряжение на сверхрешетке соответствует критическому $U*_{SI}=1.25$. и штрихпунктирной линиями показаны случаи, когда напряжение оказывается меньше и больше порогового, соответственно. Видно, что при пороговом напряжении существует возмущение, для которого выполняется условие (6). В системе возникают колебания, причем, их частота равна частоте колебаний о найденного возмущения. Полученный результат отлично соответствует численному расчету.

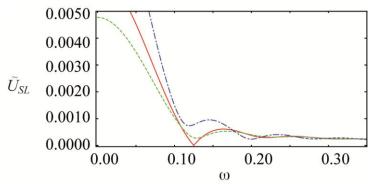


Рис. 1. Значения интеграла (6) для возмущений, характеризующихся нулевым значением коэффициента затухания λ и имеющих разные частоты ω . Сплошная линия соответствует, случаю, когда напряжение на сверхрешетке равно пороговому значению $U^*_{SL}=1.25$.

Очевидно, что приведенный выше метод позволяет находить возмущение, существующее в сверхрешетке при заданном напряжении и характеризующееся определенным коэффициентом затухания (нарастания) и частотой. Таким образом, можно провести анализ полученного возмущения в области больших напряжений. На рисунке 2a показана зависимость коэффициента нарастания возмущения λ от напряжения на сверхрешетке, на рисунке 2b — частота возмущения. Точками отмечены значения частоты колебаний тока, текущего через сверхрешетку $J=nv_d(F)$, полученные численно при данном значении U_{SL} . Видно, что частота колебаний тока хорошо соответствует частоте возмущения. Результаты численного моделирования свидетельствуют о том, что генерация в рассмотренной сверхрешетке прерывается при больших напряжениях. В этом случае значение коэффициента λ оказывается равным нулю (рис. 2a).

Труды школы-семинара «Волны-2013»

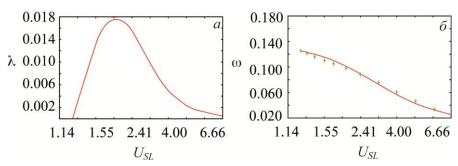


Рис. 2. Зависимость коэффициента нарастания (а) и частоты (б) возмущения от напряжения на сверхрешетке. Точками показаны значения частоты колебаний тока в сверхрешетке, вычисленные по временным рядам

В работе проведен анализ устойчивости стационарного состояния полупроводниковой сверхрешетки. Показано, что при пороговом значении напряжения в системе появляется возмущение с нулевым коэффициентом затухания. При этом частота возникших колебаний тока равна частоте полученного возмущения. Анализ данного возмущения в области больших напряжений показывает, что колебания в системе возможны, пока его коэффициент нарастания положителен, а частота колебаний тока соответствует частоте колебаний возмущения при всех значениях управляющего параметра. Таким образом, обнаружена связь между динамикой возмущения и характеристиками генерируемых колебаний тока. Полученные аналитически результаты отлично соответствуют результатам численного моделирования. Проведение подобного анализа позволяет рассчитать значение напряжения, необходимого для генерации колебаний тока, а также оценить частоту возникших колебаний.

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых — кандидатов (МК-672.2012.2) и докторов (МД-345.2013.2) наук, ведущих научных школ (проект НШ-1430.2012.2), а также РФФИ (проект 12-02-33071).

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Esaki L., Tsu R. // IBM Journal of Research and Development. 1970. V. 14. No. 1. P. 61.
 - 2. Hyart Timo et. al. // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 103, P. 117401.
- 3. Kroemer H. // IEEE Transactions On Electron Devices 1968. V. ED-15. No. 11. P. 819.
 - 4. Fromhold T.M. et. al. // Nature 2004. V. 428. P. 726.